用于高能物理实验的单片高压 CMOS(HV-CMOS)像素粒子探测器



张晨凡 利物浦大学物理学院 chenfan@liverpool.ac.uk





• 居里夫人青年研究员 (Marie Curie Early Stage Researcher) @ 利物浦大学

- 研制了RD50-MPW1: 第一款带有像素内数字读出电路的单片高压 CMOS (HV-CMOS)粒子探测器 (~ 60 V)。
- 物理学博士研究生 @ 利物浦大学
 - 研制了RD50-MPW2 与 UKRI-MPW0, 将HV-CMOS的可承受电压升高 到了120 V, 进一步提升了抗辐照性能。

• 研究员 @ 利物浦大学

- 研制了RD50-MPW3, RD50-MPW4 与 UKRI-MPW1, 将可承受电压升 高到了600 V以上,实现了拥有完整数字读出的HV-CMOS探测器。















- 硅高能粒子探测器
- 硅像素探测器
 - 混合式 (Hybrid)
 - 单片式 (Monolithic)
 - 单片高压CMOS (Monolithic HV-CMOS)
- RD50-MPW4
 - 设计
 - 测试结果
- 总结



张晨凡利物浦大学 HV-CMOS像素探测器



对撞机实验中粒子轨迹的记录













• 像素大小

- 抗辐射性能
- 时间分辨率
- 物质量
- 功耗
- 噪声
- 单探测器面积大小
- 集成工艺难易程度
- 良率





Santa, my wish			
2	→	small (a few µm²)	
n tolerand	e →	high (> 10 ¹⁷ 1MeV n _{eq} /cm ²)	
olution	→	excellent (< 100 ps)	
budget	→	minimal (< 50 μm)	
onsumption \rightarrow minimal (~10-100/cm ²)			
	\rightarrow	minimal	
ize	→	large	
j process	→ as easy as possible		
	→	high (and cheap price!!!)	
physicists			

张晨凡利物浦大学 HV-CMOS像素探测器

硅轨迹探测器

- 从80年代开始,在高能物理实验里被应用.
- 相对于当时探测器,极大提高了的空间精度:
 - Multi-wire proportional chambers (< 1 mm)
 - Drift chambers (~ 100 µm)
- 两种硅轨迹探测器的变种:
 - 硅微条 (~ 10 µm)
 - ▶ 100 / cm²
 - 硅像素 (~ 10 µm)
 - ► 5000 / cm²
 - ▶ 3维轨迹探测
 - 有能力应对高密度,高速率的粒子束
 - 抵抗高强度的辐射环境 -> 能被应用在靠近对撞点的空间









硅探测器的工作原理

- 对PN二极管加反相偏置电压, 在PN结之间形成耗尽层 (没有自由电子/空穴).
- 耗尽层厚度 $W \propto \sqrt{V_{bias}} \cdot \rho$.
- 高能带电粒子与硅通过电离产生自由电子/空穴对.
- 在耗尽层中产生的电子/空穴, 在偏执电压形成的电场的作用下向电极漂移.
- 电极收集的电子或空穴形成电信号.
- 辐射在硅材料中产生伤害,减少耗尽层厚度,维持耗尽层 -> 增大偏置电压 V_{bias} ,基底电阻ho.





incident particle



- 收集到的电信号通过读出电路放大,数字化.
- 输出电信号的到达时间,大小,与像素地址.





张晨凡利物浦大学 HV-CMOS 像素探测器



混合式像素探测器

- 硅探测器与读出电路分别在不同的硅片上 (hybrid).
- 分别使用不同技术, 使探测器与读出电路达到最佳性能:
 - 探测器使用最佳材料以提高抗辐射能力;
 - 读出电路使用小节点工艺从而提高读取速度.

silicon sensor 250 µm

readout chip

180 µm

- 通过金属球连接 (像素大小 > 50 µm × 50 µm).
- 双层结构 -> 厚度 > 300 µm.
- 工艺复杂, 昂贵 (> 900万/m²).





- 用于需要超高读出速度的场合.
- 被ATLAS, CMS, ALICE使用在最靠近对撞点的位置.
- 高能物理实验中面积最大的像素探测器系统 (~ 10 m²).













单片式像素探测器

- 硅探测器与读出电路集成在同一块硅片上 (monolithic), 使用普通CMOS工艺.
- 单层结构 -> 厚度可以减少到50 µm.
- 无需使用金属球连接 (像素大小可达到18 μm × 18 μm).
- 工艺更简单,造价更低 (~ 90万/m²).
- 低偏置电压(< 10 V) -> 有限的耗尽层深度, 有限的抗辐射能力(10¹³ 1MeV n_{eq}/cm²).
- 用于需要高空间精度的实验.







张晨凡利物浦大学 HV-CMOS像素探测器



单片高压CMOS像素探测器

- 在单片像素探测器的基础上, 使用高压CMOS(HV-CMOS)工艺, 和高电阻(HR)的硅晶圆作为基底.
- 深井(deep n-well)既作为电子收集电极, 也把低电压的读出电路与高电压的基底隔开.
- 强化耗尽层 ($W \propto \sqrt{V_{bias}} \cdot \rho$), 基底可以完全耗尽 -> 更好的抗辐射性能 (> 10¹⁵ 1MeV n_{eq}/cm²).
- 源于汽车工业 -> 可以以较低成本大量制造.





HV-CMOS像素探测器

- 第一次被应用在瑞士Paul Scherrer Institute (PSI) 的Mu3e实验中 (µ+ -> e+ e+ e-).
 - 低探测器质量: 探测器厚度 50 µm
 - 高空间精度: 像素面积 80 µm × 80 µm
- LHCb Upgrade II中的Mighty Tracker与UP已选择使用HV-CMOS作为它们的像素探测器技术.
 - 高抗辐射性能: Mighty Tracker (3 × 10¹⁴ 1MeV n_{eq}/cm²), UP (3 × 10¹⁵ 1MeV n_{eq}/cm²).











RD50-MPW与UKRI-MPW







RD50-MPW4

- LFoundry代工厂的150 nm HV-CMOS工艺.
- •制造了三块3 kΩ·cm的高阻硅晶圆,并打磨减薄到280 µm:
 - 一块晶圆上的探测器使用传统方法,从正面附加高电压;
 - 另两块进行了背部处理(p+掺杂), 实现从背部加高压.





到280 μm: 加高电压; 加高压.







RD50-MPW4 - 改进的加压方式

• 根据TCAD仿真, 通过背部加压得到更整齐的电场分布与强度. 电场线和电场强度:







RD50-MPW4

- 主要由一个64×64的像素阵列与数字读出电路构成:
 - 像素阵列使用与FE-I3读出芯片类似的结构,
 - 信号之间的串扰噪声.
 - 据读出(640Mbit/s).





RD50-MPW4 - 像素内电路

- 接收40 MHz 8-bit时钟信号.
- 读出8-bit上升沿时间戳, 8-bit下降沿时间戳, 8-bit像素地址.
- •比较器的阈值可以通过4-bit的DAC调节,用以平衡像素间 的差异.







• 在Ljubljana反应堆用中字辐射到不同剂量: 1e14, 3e14, 1e15, 3e15, 1e16 n_{eq}/cm².



• 发现在切割过程中产生的损伤.











数据读出系统 DAQ

- 基于Caribou系统的Control and Readout (CaR) Board.
- Xilinx Zynq-7000 FPGA.
- 定制的探测器载板.





张晨凡利物浦大学 HV-CMOS 像素探测器



时间分辨率

- 使用红外激光, 从背部向未经过处理的探测器耗尽层注入定量 的电子, 通过ToT测量注入的电子量.
- 多次注入,测量比较器上升沿到达时间(ToA)的不确定性σ_{ToA}.









张晨凡利物浦大学 HV-CMOS像素探测器



S曲线测量





- 2024年4月, 德国汉堡DESY, 4.2 GeV 电子束, 测试未经辐射的探测器.
- Trigger: 2 scintillators via AIDA2020-TLU; Telescope: Adenium (6 Alpide planes); Analysis: Corryvreckan.
- 空间分辨率 17.59 μm, 接近预期值(62 μm /√12 ≈ 17.9 μm).
- 当高压大于50 V时, 探测有效率 > 99.99%.
- 探测有效率在阈值电压大于200 mV (5000 e-)时开始变小.
- 背部加压带来了更好的电场分布 -> 更高的有效率.



张晨凡利物浦大学 HV-CMOS像素探测器









- 2024年10月, DESY, 测试经过辐射的探测器, 冷却到 -15°C.
- 初始工作情况: 190 V高压, 200 mV阈值电压 (杜绝噪声干扰).
- 探测有效率随着辐射剂量降低.

DUT	Total Efficiency
0E00	99.8%
1E14	99.5%
3E14	85.5%
1E15	8.9%

• 像素内有效率在角落因为电荷与邻近 像素分享而降低.







RD50_MPWx_0 Pixel efficiency map



RD50_MPWx_0 Pixel efficiency map



张晨凡利物浦大学 HV-CMOS像素探测器





- 改进工作情况: 增大偏置高压, 降低阈值电压.
- 辐射剂量为1E14与3E14的探测器仍可达到 99.9%的有效率.
- 1E15的探测器未经过背部处理,从正面加高压, 可达到98.7%的有效率.
- 已将更多的探测器送去辐射: 5E14, 1E15, 2E15, 3E15, 5E15; 包括未经背部加压的样品.
- 第三轮束流测试在2025年6月,更精细地了解 HV-CMOS的抗辐射性能,和背部加压对抗辐射 性能的影响.
- 测量粒子到达的时间戳, 时间分辨率约为10 ns (时钟周期 25 ns).







研发计划

- 在RD50-MPW4的基础上,设计RadPix探测器,作为LHCb Upgrade II中的Mighty Tracker与UP的备选方案.









功耗

- LHCb Mighty Tracker要求功耗小于 150 mW/cm².
- RD50-MPW4的像素阵列消耗约 600 mW/cm².
- 仿真模拟:当放大像素面积到 80 µm × 80 µm,以及使用低功耗模式, 功耗可降至 180 mW/cm². 99%的粒子可在25 ns的窗口内被探测到.
- 需进一步优化像素电路.





张晨凡利物浦大学 HV-CMOS像素探测器



transient noise simulation





- 单片高压CMOS (HV-CMOS)探测器在未来的高能物理实验如CEPC, HL-LHC, FCC中有着巨大的应用前景:
 - 单层硅晶片: 更薄的探测器厚度 (50 µm)
 - 较小的像素面积 (50 µm × 50 µm)
 - 较低的制造成本 (~ 90万/m²)
 - 较好的抗辐射性能 (> 10¹⁵ 1MeV n_{eq}/cm²)
- 使用更小的技术节点 (55 65 nm), 进一步减小像素面积, 提高数据读出速率和 抗电离辐射能力.
- 拓展粒子探测器在高能物理实验以外的应用场景, 如辐射监测、医疗放射计量 控制和宇宙高能粒子探测等潜在应用前景.



张晨凡利物浦大学 HV-CMOS 像素探测器





一作或通讯作者:

CERN-RD50 collaboration, POS (2020), https://doi.org/10.22323/1.370.0045.

Journal of Instrumentation (2022), https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/C09025.

NIM-A (2022), https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167214.

[4] P. Sieberer, C. Zhang et al., RD50-MPW3: a fully monolithic digital CMOS sensor for future tracking detectors, Journal of Instrumentation (2023), https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/02/C02061.

tolerance, Journal of Instrumentation (2024), https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/C03061.

C04059.

biasing, Journal of Instrumentation (2024), http://doi.org/10.1088/1748-0221/19/11/p11011.

radiation tolerance, Journal of Instrumentation (2024), accepted for publication.



- [1] C. Zhang et al., Development of RD50-MPW2: a high-speed monolithic HV-CMOS prototype chip within the
- [2] C. Zhang et al., High-performance HV-CMOS sensors for future particle physics experiments an overview,
- [3] C. Zhang et al., Design and evaluation of UKRI-MPW0: An HV-CMOS prototype for high radiation tolerance,
- [5] C. Zhang et al., Measurement of UKRI-MPW0 after irradiation: an HV-CMOS prototype for high radiation
- [6] C. Zhang et al., RD50-MPW: a series of monolithic High Voltage CMOS pixel chips with high granularity and towards high radiation tolerance, Journal of Instrumentation (2024), https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/
- [7] C. Zhang et al., Design and evaluation of UKRI-MPW0: a monolithic HV-CMOS pixel sensor with backside
- [8] C. Zhang et al., Design and evaluation of UKRI-MPW1: a monolithic HV-CMOS pixel sensor with high

